

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2001年4月12日 (12.04.2001)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 01/25853 A1

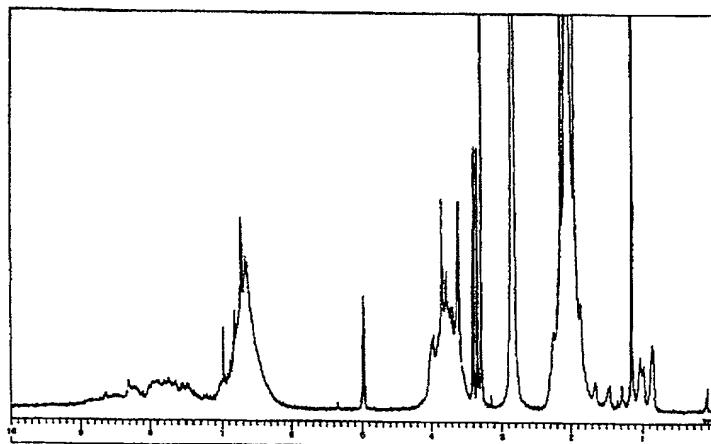
|               |  |  |  |                |
|---------------|--|--|--|----------------|
| (51) 国際特許分類:  | G03F 7/023,<br>C08L 33/06, H01L 21/027   | 特願2000/47391<br>特願2000/201837<br>特願2000/255215   | 2000年2月24日 (24.02.2000)<br>2000年7月4日 (04.07.2000)<br>2000年8月25日 (25.08.2000) | JP<br>JP<br>JP |
| (21) 国際出願番号:  | PCT/JP00/06903   | (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): クラリ<br>アントインターナショナルリミテッド (CLARIANT<br>INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; CH-4132 ムッテン<br>ツ 1 ロートハウスシュトラーセ 61 Muttenz (CH). |  |                |
| (22) 国際出願日:   | 2000年10月4日 (04.10.2000)  | (72) 発明者; および  |  |                |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語  | (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋修一 (TAKA<br>HASHI, Shuichi) [JP/JP]; 〒437-1496 静岡県小笠郡大<br>東町千浜3810 クラリアント ジャパン株式会社内<br>Shizuoka (JP).                 |  |                |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語  | (74) 代理人: 鎌尾宏紀, 外 (KANO, Hiroki et al.) ; 〒<br>101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目10番14号<br>ばんだいビル むつみ国際特許事務所 Tokyo (JP).                                   |  |                |
| (30) 優先権データ:  | 特願平11/286418 1999年10月7日 (07.10.1999) JP<br>特願平11/333048 1999年11月24日 (24.11.1999) JP<br>特願平11/362994 1999年12月21日 (21.12.1999) JP<br>特願平11/367237 1999年12月24日 (24.12.1999) JP<br>特願2000/45430 2000年2月23日 (23.02.2000) JP | (81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.   |  |                |

[統葉有]

TITLE ✓

(54) Title: PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(54)発明の名称: 感光性組成物



ノボラック樹脂: アクリルポリマー = 100:10 (レジストフィルム)

NOVOLAK RESIN/ACRYLIC POLYMER = 100/10 (RESIST FILM)

(57) Abstract: A photosensitive composition comprising a resin composition and a photosensitive substance and useful as a photoresist, wherein the resin composition is either a mixture of two or more resins among which the difference in refractive index is at least 0.03 or a mixture of an alkali-soluble resin as a base resin with as a resinous additive a resin functioning as a dissolution inhibitor for the photosensitive composition, such as an acrylic polymer, methacrylic polymer, or styrene polymer. The photosensitive composition is preferably one having a rate of dissolution in 2.38 wt.% tetramethylammonium hydroxide solution of 5,000 Å/min or lower. Use of the resin composition is effective in reducing the amount of a quinonediazide photosensitizer to be used and in obtaining a photosensitive composition satisfying both of high sensitivity and high film thickness retention.

[統葉有]

WO 01/25853 A1